

# JSPP2017

EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing

## 82nd IUVSTA

82nd IUVSTA Workshop on Plasma-based Atomic Layer Processes

Dates : December 4-7, 2017

Venue : 万国津梁館(沖縄) Bankoku Shinryokan, Okinawa



### 展示会のお誘い

日欧プラズマプロセス共同シンポジウム (EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing) の活動に関しまして、平素より格別の御高誼を賜り、厚く御礼を申し上げます。

さて、掲題の『第10回日欧プラズマプロセス共同シンポジウム (JSPP2017)』を、本年12月4日～7日の4日間にわたり、沖縄県名護市の万国津梁館で開催する運びとなりました。本シンポジウムは、プラズマプロセスおよびその関連分野の科学技術に関する国際シンポジウムです。第一回が2003年にスウェーデンのストックホルムで開催されて以来、1年から3年の間隔をおいて、ヨーロッパと日本の間で、交互に開催され、今回で10回を迎えました。この10回の会議を重ねる間に、世界の情報通信技術 (ICT) に対する需要が大きく変化し、産業界で必要とされるプラズマ技術も大きな変遷を遂げました。今回の会議では、新しいプラズマ技術として近年注目されている大気圧プラズマに注目して、通常のセッションに加えて、「プラズマ液体相互作用」および「プラズマの農業応用」に関する特別セッションを組みました。

また、今回は、同シンポジウムと並行して、同じ会議場で、国際真空科学・技術・応用連合 (IUVSTA) の主催する『プラズマ支援原子層プロセスに関する第82回IUVSTA ワークショップ (82nd IUVSTA Workshop on Plasma-based Atomic Layer Processes)』も開催いたします。このワークショップでは、近年急速に発展を遂げている原子層堆積 (ALD)、原子層エッチング (ALE) 等、原子スケールの精度をもつプラズマプロセスの基礎および応用研究について集中的に議論します。

これら両会議は、プラズマ科学・技術の基礎から応用に携わる世界の研究者が一堂に会するユニークな会議であり、国内外の大学・国公立研究所・企業等から、研究者や学生、約100名の参加を見込んでいます。本シンポジウムでは、この両会議の参加者を対象に、企業様からの展示出展を募集しております。つきましては、貴社におかれましては、出展のご検討を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

日欧プラズマプロセス共同シンポジウム実行委員長  
大阪大学 教授  
浜口智志

### Session Plan (Tentative)



#### JSPP

Atomic and molecular processes in plasmas  
Collision cross sections  
Fundamentals of low temperature plasmas  
Plasma-surface interactions  
Plasma diagnostics  
Modeling and numerical simulations of plasmas and surfaces  
Atmospheric/high-pressure plasmas  
Plasmas in (contact with) liquids  
Plasma processing of materials, including etching and deposition  
Plasma application for nanotechnologies  
Plasma application for biology, medicine, and environments  
Other plasma science and technologies  
Special Session: Plasma-Liquid Interactions  
Special Session: Plasma Application to Agriculture

### Scope of Workshop

#### IUVSTA

- Plasma-based Atomic Layer Deposition (ALD): fundamentals & applications
- Plasma-based Atomic Layer Etching (ALE): fundamentals & applications
- Surface chemistry of self-limiting reactions
- Liquid-based atomic-scale material processes
- Control of low-pressure plasmas for low-damage processing
- Modeling and diagnostics of low-pressure plasmas for low-damage processing

Sponsored by International Union for Vacuum Science, Technique and Applications (IUVSTA)   
The Vacuum Society of Japan (VSJ)   
Division of Plasma Electronics The Japan Society of Applied Physics (JSAP)

## Organizing Committee

### JSP

Satoshi Hamaguchi	(Chair, Osaka University, Japan)
Nigel Mason	(Co-Chair, Open University, UK)
Zoran Petrovic	(Co-Chair, Institute of Physics, Serbia)
Fumiyoichi Tochikubo	(Co-Chair, Tokyo Metropolitan University, Japan)
Katsuhisa Kitano	(Secretary, Osaka University, Japan)
Uroš Cvelbar	(Jožef Stefan Institute., Slovenia)
Uwe Czarnetzki	(Ruhr University Bochum, Germany)
William G. (Bill) Graham	(Queen's University Belfast, UK)
Seiji Samukawa	(Tohoku University, Japan)
Masaharu Shiratani	(Kyushu University, Japan)
Peter L. G. Ventzek	(Tokyo Electron America, USA)

### IUVSTA

Satoshi Hamaguchi (Chair), Osaka University, Japan
Timo Gans (Co-Chair), University of York, JK
Keizo Kinoshita (Co-Chair), Petra, Japan
Tetsuya Tatsumi (Co-Chair), Sony Semiconductor Solutions, Japan
Sumit Agarwal, Colorado School of Mines, USA
Masanobu Honda, Tokyo Electron, Japan
Eric Joseph, IBM, USA
Kazuhiro Karahashi, Osaka University, Japan
Erwin Kessels, Eindhoven University of Technology, Netherlands
Shahid Rauf, Applied Materials, USA
Guen Young Yeom, Sungkyunkwan University, Korea

## Exhibition

**Location** 万国津梁館(沖縄)オーシャンホール  
Bankoku Shinryokan, Okinawa

### Exhibit Hours

Dec. 4 (Mon.)	9:00am - 6:30pm
Dec. 5 (Tue.)	9:00am - 12:00noon
Dec. 6 (Wed.)	9:00am - 6:30pm

### Installation

Dec. 3 (Sun.)	5:00pm - 8:00pm
Dec. 4 (Mon.)	8:00am - 9:00noon

### Diamantling

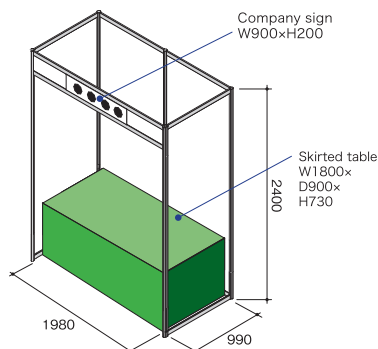
Dec. 6 (Thu.)	6:30pm - 7:30pm
---------------	-----------------

## Exhibit Fee

**108,000JPY / 1 Booth**

### Booth Specification

Size: W1980 x D990 x H2400  
Includes: Company sign, back wall,  
1 display table, 1 chair, 1 electrical outlets



**Application DEADLINE**  
**November 2, 2017**

## Advertisements

### Abstract

Space & Color	Exhibitor	Standard
4th Cover 4 Color	64,800JPY	108,000JPY
3rd Cover 4 Color	43,200JPY	75,600JPY
2nd Cover 4 Color	54,000JPY	86,400JPY
Back page B&W	32,400JPY	43,200JPY

**Application DEADLINE**  
**November 2, 2017**

【問い合わせ先】

株式会社日刊工業コミュニケーションズ Nikkan Kogyo Communications, Inc.

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-7-10 茅場町第3長岡ビル

TEL : 03-5614-3080 (代表) FAX : 03-5614-3011 Email : shindo@nikkanad.co.jp

**NKCOMS**  
日刊工業コミュニケーションズ

**Company Information**

会社名 / Company			
出展責任者 Person in charge	部署名 / Department	Name <span style="float:right">Ⓜ</span>	
住所 / Address			TEL : FAX :
出展担当者 Contact Person	部署名 / Department	Name <span style="float:right">Ⓜ</span>	E-mail: TEL: Emergency Contact Number:
Web Address			

**Exhibition Details**

Booth	108,000JPY x (     ) unit =	JPY
※展示オプションは別途ご相談ください。		
プログラム広告 Program Advertising	Location (     ) x (     ) page =	JPY
<b>Total</b>		<b>JPY</b>

上記内容にてご請求申し上げます。

Remarks;

出展物 Your Exhibit Items	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---------------------------	-------------------------

Signature \_\_\_\_\_

年 月 日

The undersigned hereby authorizes Nikkan Kogyo Communications, Inc. to reserve exhibit- Sponsor space for use by this company during The JSPP 2017/ 82<sup>nd</sup> IUVSTA indicated and acknowledges receipt of and agrees to abide by the Rules and Regulations governing each respective Exposition.

**Return Application to; Nikkan Kogyo Communications, Inc.**  
FAX. +81-3-5614-3011 or E-mail. shirane@nikkanad.co.jp